

【11】證書號數：M451245

【45】公告日：中華民國 102 (2013) 年 04 月 21 日

【51】Int. Cl. : *B32B18/00 (2006.01)* *C04B35/43 (2006.01)*

新型

全 3 頁

【54】名稱：多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構

【21】申請案號：101221972 【22】申請日：中華民國 101 (2012) 年 11 月 14 日

【72】新型創作人：陳宏仁 (TW)；高銘政 (TW)；楊尚霖 (TW)

【71】申請人：修平學校財團法人修平科技大學
臺中市大里區工業路 11 號

【74】代理人：何崇民

[57]申請專利範圍

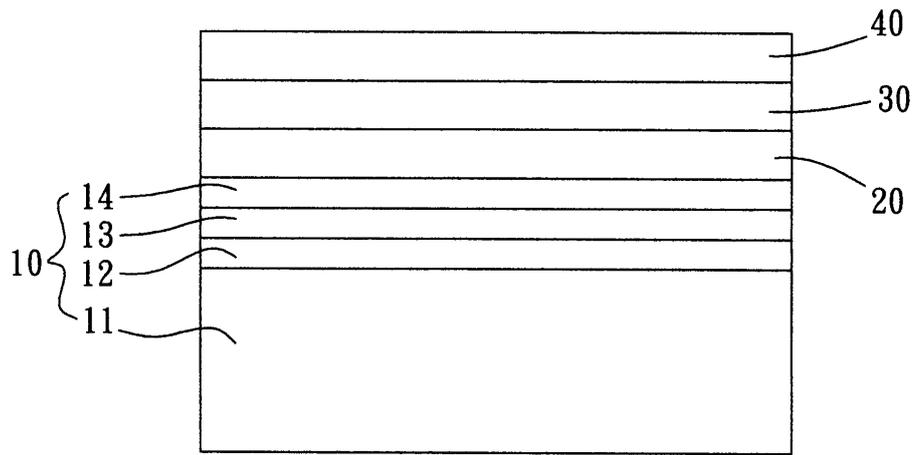
1. 一種多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其構成包含一基體，以及依序層疊設於該基體上之鐵電層，係設於該基體上；一超巨磁阻磁性層，係設於該鐵電層上；一多鐵材料層係設於該超巨磁阻磁性層上。
2. 依據申請專利範圍第 1 項所述之多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其中該鐵電層化學式可為 $\text{Bi}_{3-x} \text{A}_x \text{Ti}_3 \text{O}_{12}$ 。
3. 依據申請專利範圍第 1 項所述之多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其中該超巨磁阻磁性層化學式可為 $\text{La}_{0.7-x} \text{Ln}_x \text{Pb}_{0.3} \text{MnO}_3$ 。
4. 依據申請專利範圍第 1 項所述之多鐵性之鐵磁材料複合薄膜結構，其中該多鐵材料層化學式可為 $\text{Bi}_{1-x} \text{B}_x \text{FeO}_3$ (鐵酸鉍)。

圖式簡單說明

第一圖：係本創作之組合剖面圖。

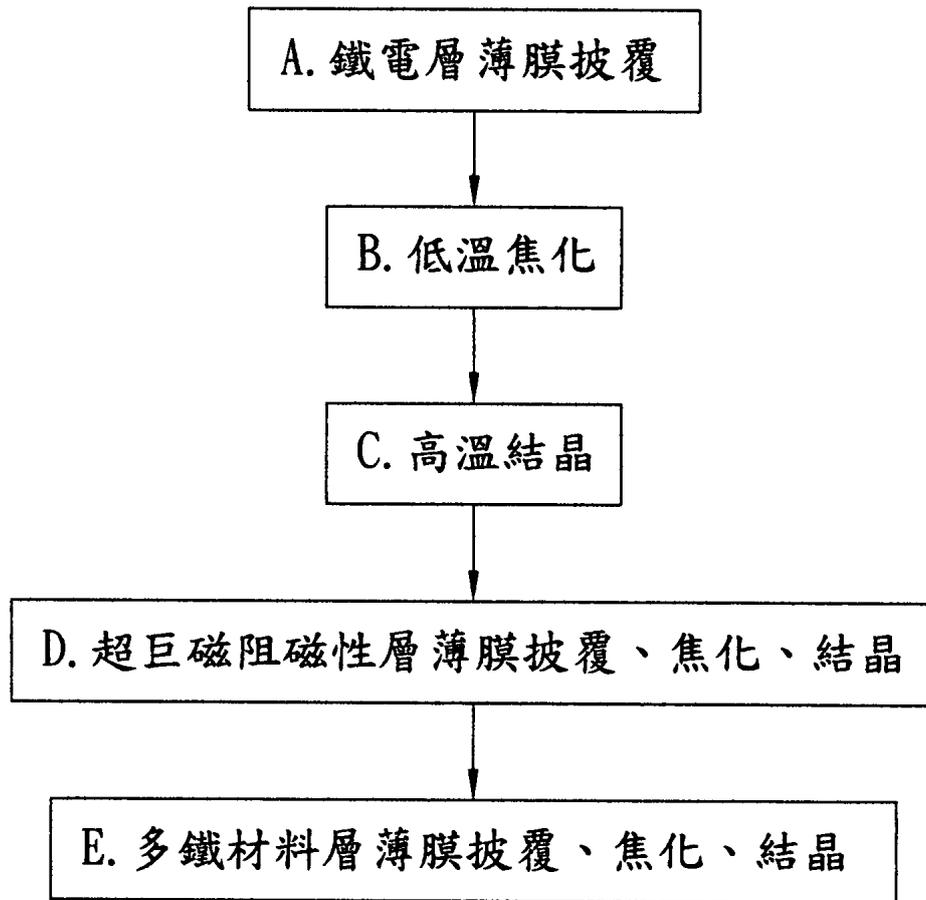
第二圖：係本創作薄膜披覆成型步驟方塊圖。

(2)



第一圖

(3)



第 二 圖